PRODUCTION OF ALPHA-OLEFIN OLIGOMER

Publication number: JP8059732 Publication date: 1996-03-05

Inventor: URATA HISAO; AOSHIMA NORIYUKI; OSHIKI

TOSHIYUKI; TAKAHARA JUN; IWADE SHINJI; NANBA

YOSHIAKI

Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international: C08F4/69; C07C2/08; C07C11/107; C08F4/42;

C08F4/60; C08F10/00; C08F4/00; C07C2/00; C07C11/00; C08F10/00; (IPC1-7): C08F4/69;

C08F10/00

- European:

Application number: JP19950068623 19950301

Priority number(s): JP19950068623 19950301; JP19940135728 19940617

Report a data error here

Abstract of JP8059732

PURPOSE: To obtain the subject polymer in high yield and high selectivity by using a catalytic system composed of a combination of a chromium compound, an acid amide or an imide compound and a metal alkyl compound. CONSTITUTION: This method for producing &alpha -olefin oligomer, especially composed mainly of ethylene to 1-hexene is to use a catalyst system comprising a combination of (A) a chromium compound such as chromium (IV) t-butoxide, chromium (III) acetylacetonate or &beta - diketonate salt of chromium, (B) an acid amide or an imide compound of the formula (M1 is H or a metal of IA, IIA, IB and IIIB of the periodic table; R<1> and R<2> are each H, a 1-30C alkyl, an alkenyl, etc., or R<1> and R<2> together forma ring) and a metal alkyl compound such as an alkylaluminum compound.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-59732

(43)公開日 平成8年(1996)3月5日

(51) Int.Cl.⁶ 識別記号 FΙ 庁内整理番号 技術表示箇所

C08F 4/69 MFEMFG10/00

審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全22頁)

(21)出願番号 特願平7-68623 (71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 (22)出願日 平成7年(1995)3月1日

(72)発明者 浦田 尚男

(31)優先権主張番号 特願平6-135728 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 (32)優先日 平6(1994)6月17日

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(33)優先権主張国 (72)発明者 青島 敬之 日本(JP)

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 押木 俊之

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 弁理士 岡田 数彦

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 αーオレフイン低重合体の製造方法

(57)【要約】

【目的】煩雑な操作なしで工業的有利に1-ヘキセン等 の α - オレフイン低重合体を高収率かつ高選択率で製造 することが出来る α-オレフイン低重合体の製造方法を 提供する。

【構成】クロム系触媒を使用した α -オレフイン低重合 体の製造方法において、クロム系触媒として、少なくと も、クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物および金 属アルキル化合物の組み合わせから成る触媒系を使用す る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロム系触媒を使用した α ーオレフイン 低重合体の製造方法において、クロム系触媒として、少なくとも、クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物および金属アルキル化合物の組み合わせから成る触媒系を使用することを特徴とする α ーオレフイン低重合体の製造方法。

【請求項2】 酸アミド又はイミド化合物が下記一般式 (1) で表される化合物である請求項1に記載の α - オレフイン低重合体の製造方法。

【化1】

$$\begin{array}{ccc}
O & M^1 \\
\parallel & \parallel & \parallel \\
R^1 - C - N - R^2 & \cdots & (1)
\end{array}$$

(一般式 (1) 中、 M^1 は、水素原子または周期律表の I A、II A、I B、 III B 族から選ばれる金属元素であ 0、 R^1 は、水素原子、炭素数 $1 \sim 30$ のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を含んでいてもよいアリール基を表し、 R^2 は、水素原子、炭素数 $1 \sim 30$ のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテロ元素を含んでいてもよいアリール基、または、アシル基 C (=O) R^3 (R^3 は R^1 と同じ定義であり、 R^1 と異なっていてもよい)を表し、 R^1 と R^2 は環を形成してもよい。)

【請求項3】 イミド化合物として、一般式(1)中の R^2 がアシル基C (=O) R^3 であり、 R^1 と R^3 が環を形成しているイミド化合物を使用する請求項2に記載の α - オレフイン低重合体の製造方法。

【請求項4】 酸アミド又はイミド化合物が下記一般式 30 (2) で表される化合物である請求項1 に記載の α - オレフイン低重合体の製造方法。

【化2】

(一般式(2)中、 M^2 及び M^3 は、水素原子または周期律表の I A、I I A、I B、I III B 族から選ばれる金属元素であり、 R^4 及び R^5 は、水素原子、炭素数 $1\sim3$ 0のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基 40 を有していてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を含んでいてもよいアリール基を表し、 R^4 と R^5 は環を形成していてもよく、A は不飽和結合を含んでいてもよいアルキレン基を表す。)

R16 OH

(一般式(6)中、R¹⁶は、水素原子、炭素数1~30 のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を 有していてもよいアリール基、ヘテロ元素を含んでいて もよいアリール基、ハロゲン化アルキル基、アシル基C (=O) R¹⁷(R¹⁷はR¹⁶と同じ定義であり、R¹⁶と異 *【請求項5】 酸アミド又はイミド化合物が下記一般式 (3) で表されるスルホンアミド又はスルホンイミドで ある請求項1に記載のαーオレフイン低重合体の製造方

[化3]

$$\begin{array}{c}
M^4 \\
R^6 - SO_2 - N - R^7
\end{array}$$
... (3)

(一般式(3)中、M4 は、水素原子または周期律表の10 IA、IIA、IB、IIIB族から選ばれる金属元素であり、R6 は、水素原子、炭素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基を表し、R7 は、水素原子、炭素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテロ元素を含んでいてもよいアリール基、ステロ元素を含んでいてもよいアリール基、または、SO2R8 基(R8 はR6 と同じ定義であり、R6 と異なっていてもよい)を表し、R6 とR7 は環を形成してもよい。)

② 【請求項6】 ハロゲン含有化合物の存在下に反応を行う請求項1~5の何れかに記載のα-オレフイン低重合体の製造方法。

【請求項7】 下記一般式(4)又は(5)で表される 化合物の存在下に反応を行う請求項 $1\sim5$ の何れかに記載の α -オレフイン低重合体の製造方法。

【化4】

$$[L]^{+} \begin{bmatrix} R^{9} \\ [R^{12} - M^{5} - R^{10}]^{-} \\ R^{11} \end{bmatrix}$$
 ... (4)

$$R^{13}$$
 $R^{15} - M^{6} - R^{14}$ --- (5)

(一般式(4)及び(5)中、 M^5 及び M^6 は、周期律表のIII B、IVB、VB、VIB族から選ばれる金属元素であり、 R^9 ~ R^{15} は、有機基、無機基または陰性原子を表し、[L] + は、周期律表のIA、VIIA、VIII、IB及びIII B~VIB族から選ばれる元素を含むカチオンを表す。)

【請求項8】 下記一般式(6)で表される化合物の存在下に反応を行う請求項1~5の何れかに記載のα-オレフイン低重合体の製造方法。

【化5】

··· (6)

なっていてもよい)、または、 R^{18} S O_2 基(R^{18} は R^{16} と同じ定義であり、 R^{16} と異なっていてもよい)を表す。)

もよいアリール基、ハロゲン化アルキル基、アシル基 $oxtom{C}$ 【請求項 $oxtom{9}$ 】 $oxtom{\alpha}$ 一オレフインがエチレンであり、 $oxtom{\alpha}$ 一 ($oxtom{=}O$) $oxtom{R^{17}}$ は $oxtom{R^{16}}$ と同じ定義であり、 $oxtom{R^{16}}$ と異 $oxtom{50}$ オレフイン低重合体が主として $oxtom{1}$ ーヘキセンである請求

項 $1 \sim 8$ の何れかに記載の α -オレフイン低重合体の製 造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、 α-オレフイン低重合 体の製造方法に関するものであり、詳しくは、特に、エ チレンから1-ヘキセンを主体とした $\alpha-$ オレフイン低 重合体を高収率かつ高選択率で製造することが出来る工 業的有利な α - オレフイン低重合体の製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来から、エチレン等の αーオレフイン の低重合方法として、特定のクロム化合物と特定の有機 アルミニウム化合物の組み合せから成るクロム系触媒を 使用する方法が知られている。例えば、特公昭43-1 8707号公報には、クロムを含むVIA族の遷移金属 化合物とポリヒドロカルビルアルミニウムオキシドから 成る触媒系により、エチレンから1-ヘキセンとポリエ チレンを得る方法が記載されている。

【0003】また、特開平3-128904号公報に は、クロムーピロリル結合を有するクロム含有化合物と 金属アルキル又はルイス酸とを予め反応させて得られた 触媒を使用して α-オレフインを三量化する方法が記載 されている。さらに、南アフリカ特許 ZA93/035 0号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物およ び金属アルキル化合物を共通の溶媒中で混合することに より得られた触媒系を使用して、 α -オレフインを低重 合する方法が記載されている。

【0004】一方、先に本発明者らは、特願平4-24 7811号において、クロムーピロリル結合を持つクロ 30 ム含有化合物、 α - オレフイン及びアルキルアルミニウ ムの接触方法を規定することにより、α-オレフインの 低重合反応を行う方法を提案した。この方法に従えば、 特に、エチレンの低重合反応により、1-ヘキセンを驚 異的な高活性で得ることが出来る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特公昭 43-18707号公報に記載された方法では、1-へ キセンと同時に生成するポリエチレンの量が多く、ポリ エチレンの副生量を少なくした条件では、触媒活性が低 40 下するという問題がある。また、特開平3-12890 4号公報に記載された方法は、高分子量重合体の生成量 は少ないが、触媒活性が十分でないという問題がある。 しかも、特開平3-128904号公報に記載の方法 は、αーオレフインの低重合プロセスの他に、クロムー ピロリル結合を有するクロム含有化合物を触媒として使 用するため、クロム塩と高価なピロール又は2、5-ジ メチルピロールから得られる金属ピロライドとの反応工 程および得られたクロム含有化合物の単離工程を必要と し、操作が煩雑であるばかりか、触媒製造プロセスを含 50 は、酸素、ハロゲン等が挙げられる。

めた全体の製造プロセスに要する建設費が高いという欠 点がある。さらに、クロムーピロリル結合を有するクロ ム含有化合物は、空気や湿度に対して極めて不安定な物 質であるため、その取扱が容易ではないという欠点もあ る。

【0006】また、南アフリカ特許ZA93/0350 号公報に記載された方法は、上記と同様に、高価なピロ -ル又は2,5-ジメチルピロールを使用した触媒の前 調製工程、および、触媒の単離工程を必要とし、操作が 煩雑であるばかりか、全体の製造プロセスに要する建設 10 費が高いという欠点がある。

【0007】本発明は、上記実情に鑑みなされたもので あり、その目的は、煩雑な操作なしで工業的有利に1-ヘキセン等の α - オレフイン低重合体を高収率かつ高選 択率で製造することが出来る α-オレフイン低重合体の 製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目 的を達成すべく鋭意検討を進めた結果、特定のクロム系 触媒を使用するならば、α-オレフインの低重合反応、 特に、エチレンの三量化を主体とする低重合反応が、高 活性に進行して高純度の1-ヘキセンが生成するとの知 見を得た。本発明は、斯かる知見に基づいて完成された ものであり、その要旨は、クロム系触媒を使用した α-オレフイン低重合体の製造方法において、クロム系触媒 として、少なくとも、クロム化合物、酸アミド又はイミ ド化合物および金属アルキル化合物の組み合わせから成 る触媒系を使用することを特徴とする α-オレフイン低 重合体の製造方法に存する。

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に おいては、クロム系触媒として、少なくとも、クロム化 合物(a)、酸アミド又はイミド化合物(b)及び金属 アルキル化合物(c)の組み合わせから成る触媒系を使 用する。

【0010】本発明で使用するクロム化合物は、一般式 CrXnで表される。但し、一般式中、Xは、任意の有 機基または無機の基もしくは陰性原子、nは1~6の整 数を表し、そして、nが2以上の場合、Xは同一または 相互に異なっていてもよい。クロムの価数は0~6価で あり、上記の式中のnとしては2以上が好ましい。

【0011】有機基としては、炭素数が通常1~30の 各種の基が挙げられる。具体的には、炭化水素基、カル ボニル基、アルコキシ基、カルボキシル基、β-ジケト ナート基、β-ケトカルボキシル基、β-ケトエステル 基およびアミド基などが例示れる。炭化水素基として は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アル キルアリール基、アラルキル基、シクロペンタジエニル 基など等が挙げられる。無機の基としては、硝酸基、硫 酸基などのクロム塩形成基が挙げられ、陰性原子として

【0012】好ましいクロム化合物は、クロムのアルコ キシ塩、カルボキシル塩、β-ジケトナート塩、β-ケ トエステルのアニオンとの塩、または、クロムハロゲン 化物であり、具体的には、クロム(IV)tert-ブトキシ ド、クロム(III) アセチルアセトナート、クロム(III) トリフルオロアセチルアセトナート、クロム(III) ヘキ サフルオロアセチルアセトナート、クロム (III) (2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオナー ト)、Cr (PhCOCHCOPh)3 (但し、ここでP ロム(III) アセテート、クロム(III) 2-エチルヘキサ ノエート、クロム(III) ベンゾエート、クロム(III) ナ フテネート、Cr (CH₃ COCHCOOCH₃)₃ 、塩 化第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロム、臭化 第二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二クロム、フ ッ化第一クロム、フッ化第二クロム等が挙げられる。

【0013】また、上記のクロム化合物と電子供与体か ら成る錯体も好適に使用することが出来る。電子供与体 としては、窒素、酸素、リン又は硫黄を含有する化合物 の中から選択される。

【0014】窒素含有化合物としては、ニトリル、アミ ン、アミド等が挙げられ、具体的には、アセトニトリ ル、ピリジン、ジメチルピリジン、ジメチルホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、アニリン、ニトロベンゼ ン、テトラメチルエチレンジアミン、ジエチルアミン、 イソプロピルアミン、ヘキサメチルジシラザン、ピロリ ドン等が挙げられる。

【0015】酸素含有化合物としては、エステル、エー テル、ケトン、アルコール、アルデヒド等が挙げられ、 具体的には、エチルアセテート、メチルアセテート、テ *30* させずに使用する場合は、複雑な操作を伴う担体への担 トラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、ジ メトキシエタン、ジグライム、トリグライム、アセト ン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、ア セトアルデヒド等が挙げられる。

【0016】リン含有化合物としては、ヘキサメチルフ ォスフォルアミド、ヘキサメチルフォスフォラストリア ミド、トリエチルフォスファイト、トリブチルフォスフ ィンオキシド、トリエチルフォスフィン等が例示され る。一方、硫黄含有化合物としては、二硫化炭素、ジメ チルスルフォキシド、テトラメチレンスルフォン、チオ 40 フェン、ジメチルスルフィド等が例示される。

【0017】従って、クロム化合物と電子供与体から成 る錯体例としては、ハロゲン化クロムのエーテル錯体、 エステル錯体、ケトン錯体、アルデヒド錯体、アルコー ル錯体、アミン錯体、ニトリル錯体、ホスフィン錯体、 チオエーテル錯体などが挙げられる。具体的には、Cr Cl3 · 3THF, CrCl3 · 3dioxane, C $rC1_3$ · $(CH_3 CO_2 n-C_4 H_9)$, $CrC1_3$ • (CH₃ CO₂ C₂H₅), CrCl₃ • 3 (i-C₃ H7 OH)、CrC13 ・3 [CH3 (CH2)3 C 50 を含んでいてもよいアリール基、または、アシル基C

H (C₂ H₅) CH₂ OH], CrCl₃ · 3pyri dine, $CrC1_3 \cdot 2 (i-C_3 H_7 NH_2)$, [CrCls · 3 CHs CN] · CHs CN, CrCl 3 · 3 PPh3 、 CrCl2 · 2 THF、 CrCl2 · $2 \text{ pyridine}, \text{ CrCl}_2 \cdot 2 \left[(\text{C}_2 \text{ H}_5)_2 \text{ N} \right]$ H], CrCl₂ · 2 CH₃ CN, CrCl₂ · 2 [P (CH₃)₂ Ph]等が挙げられる。

【0018】クロム化合物としては、炭化水素溶媒に可 溶な化合物が好ましく、クロムのβ-ジケトナート塩、 hはフェニル基を示す。)、クロム(II)アセテート、ク 10 カルボン酸塩、 β – ケトエステルのアニオンとの塩、 β - ケトカルボン酸塩、アミド錯体、カルボニル錯体、カ ルベン錯体、各種シクロペンタジエニル錯体、アルキル 錯体、フェニル錯体などが挙げられる。クロムの各種力 ルボニル錯体、カルベン錯体、シクロペンタジエニル錯 体、アルキル錯体、フェニル錯体としては、具体的に は、Cr (CO) 6、 (C6 H 6) Cr (CO) 3、 $(CO)_{5} Cr (=CCH_{3} (OCH_{3})), (CO)$ $_{5}$ Cr (= CC $_{6}$ H $_{5}$ (OCH $_{3}$)), CpCrCl $_{2}$ (ここでCpはシクロペンタジエニル基を示す。)、(20 Cp* Cr Cl CH₃)₂ (ここでCp* はペンタメチル シクロペンタジエニル基を示す。)、(CH3)2 CrC 1等が例示される。

> 【0019】クロム化合物は、無機酸化物などの担体に 担持して使用することも出来るが、担体に担持させず に、他の触媒成分と組み合わせて使用するのが好まし い。すなわち、本発明において、クロム系触媒は、後述 する特定の接触態様で使用されるが、斯かる態様によれ ば、クロム化合物の担体への担持を行わなくとも高い触 媒活性が得られる。そして、クロム化合物を担体に担持 持を省略でき、しかも、担体の使用による総触媒使用量 (担体と触媒成分の合計量) の増大と言う問題をも回避 することが出来る。

【0020】本発明で使用する酸アミド又はイミド化合 物は、下記一般式(1)~(3)で表される化合物など が挙げられる。

【0022】一般式(1)中、M¹ は、水素原子または 周期律表のIA、IIA、IB、 IIIB族から選ばれる金 属元素であり、R¹ は、水素原子、炭素数1~30のア ルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有し ていてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を含んで いてもよいアリール基を表し、R2は、水素原子、炭素 数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテロ元素

(=O) R³ (R³ はR¹ と同じ定義であり、R¹ と異 なっていてもよい。

[0023]

【化7】

【0024】一般式(2)中、M²及びM³は、水素原 子または周期律表のIA、IIA、IB、 IIIB族から選 ばれる金属元素であり、R⁴ 及びR 5は、水素原子、炭 10 素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基、または、ヘ テロ元素を含んでいてもよいアリール基を表し、R4と R ⁵ は環を形成していてもよく、Aは不飽和結合を含ん でいてもよいアルキレン基を表す。

【0025】一般式(1)又は一般式(2)で表される 酸アミド類としては、例えば、アセトアミド、N-メチ ルヘキサンアミド、スクシンアミド、マレアミド、N-メチルベンズアミド、イミダゾール-2-カルボキソア \exists \vec{i} , \vec{i} \vec{j} $\vec{$ クタム、ε-カプロラクタム、および、これらと周期律 表のIA、IIAまたは IIIB族の金属との塩が挙げられ る。イミド類としては、例えば、1、2-シクロヘキサ ンジカルボキシイミド、スクシンイミド、フタルイミ ド、マレイミド、2,4,6-ピペリジントリオン、ペ ルヒドロアゼシン-2,10-ジオン、および、これら と周期律表のIA、IIA、IBまたは IIIB族の金属と の塩が挙げられる。

[0026]

【化8】

 $R^1 = A1 (OR^2) = H_p X_q$

--- (3)

【0032】一般式(7)中、R¹ 及びR² は、炭素数 が通常1~15、好ましくは1~8の炭化水素基であっ て互いに同一であっても異なっていてもよく、Xはハロ ゲン原子を表し、mは $0 < m \le 3$ 、nは $0 \le n < 3$ 、p $\text{tol} \leq p < 3, \quad q \text{tol} \leq q < 3 \text{ of a full of a full$ て、しかも、m+n+p+q=3である数を表す。

【0033】上記のアルキルアルミニウム化合物として は、例えば、下記一般式(8)で示されるトリアルキル※

 $R^{1}_{3}A1$

... (8)

 $R^{1} = A 1 X_{3-m} \quad (m \& 1. 5 \le m < 3)$

··· (9)

 $R^{1} = A1 + (OR^{2})$ 3-m

••• (10)

R1 m A 1 H3-m

••• (11)

(mは0 < m < 3、好ましくは1. $5 \le m < 3$)

(mは0 < m < 3、好ましくは1. $5 \le m < 3$)

【0035】上記のアルキルアルミニウム化合物の具体

ミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ジエチルアル **例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル 50 ミニウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムエトキシ**

*【0027】一般式(3)中、M4 は、水素原子または 周期律表のIA、IIA、IB、 IIIB族から選ばれる金 属元素であり、R⁶ は、水素原子、炭素数1~30のア ルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有し ていてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を含んで いてもよいアリール基を表し、R¹ は、水素原子、炭素 数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテロ元素 を含んでいてもよいアリール基、または、SO2R8基

8

【0028】一般式(3)で示されるスルホンアミド類 およびスルホンイミド類としては、例えば、ベンゼンス ルホンアミド、N-メチルメタンスルホンアミド、N-メチルトリフルオロメチルスルホンアミド、および、こ れらと周期律表のIA、IIA、IBまたは IIIB族の金 属との塩が挙げられる。

(R®はR®と同じ定義であり、R®と異なっていても

よい)を表し、R⁶ とR⁷ は環を形成してもよい。

【0029】上記の酸アミド又はイミド化合物の中、一 般式(1)で表される化合物が好ましく、特に、一般式 (1) 中のR² がアシル基C (=O) R³ を表し、R¹ とR³ が環を形成しているイミド化合物が好ましい。

【0030】本発明において、金属アルキル化合物とし ては、Li、Mg、B、Zn、Al等の金属アルキル化 合物であり、例えば、ブチルリチウム、エチルマグネシ ウムブロミド、トリレエチルボラン、ジエチル亜鉛、ま たは、アルキルアルミニウム化合物が挙げられる。これ らの中では、一般式(7)で示されるアルキルアルミニ ウム化合物が好適に使用される。

[0031]

【化9】

··· (7)

※アルミニウム化合物、一般式(9)で示されるハロゲン 化アルキルアルミニウム化合物、一般式(10)で示され るアルコキシアルミニウム化合物、一般式(11)で水素 化アルキルアルミニウム化合物などが挙げられる。な お、各式中のR1、XおよびR2の意義は前記と同じで *40* ある。

[0034]

【化10】

ド、ジエチルアルミニウムヒドリド等が挙げられる。こ れらの中では、ポリマーの副生が少ないと言う点でトリ アルキルアルミニウム又はトリアルキルアルミニウムと ハロゲン化アルキルアルミニウムとの混合物が特に好ま しい。アルキルアルミニウム化合物は、2種以上の混合 物であってもよい。

【0036】本発明においては、上記のクロム化合物 (a)、酸アミド又はイミド化合物(b)及び金属アル キル化合物(c)の組み合わせから成る触媒系を使用し 第4成分を存在させるならば、触媒活性および三量体の 選択率が更に向上するので好ましい。斯かる第4成分と しては、ハロゲン含有化合物、下記一般式(4)又は (5) で表される化合物、または、下記一般式(6)で 表される化合物が挙げられる。

[0037]

R16 OH

【0040】一般式(6)中、R¹⁶は、水素原子、炭素 数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテロ元素 20 チモン、トリエチルヘキサクロロアンチモネート、五塩 を含んでいてもよいアリール基、ハロゲン化アルキル 基、アシル基C (=O) R¹⁷ (R¹⁷はR¹⁶と同じ定義で あり、R¹⁶と異なっていてもよい)、または、R¹⁸SO 2基(R18はR16と同じ定義であり、R16と異なってい てもよい)を表す。

【0041】第4成分として用いるハロゲン含有化合物 は、ハロゲン原子が含まれる化合物であればよい。中で も、周期律表のIIIA、IIIB、IVA、IVB、 VB、VIB族から選ばれる元素を含むハロゲン含有化 合物が好ましく、ハロゲンとしては、フッ素、塩素、臭 30 2種類以上の混合物として使用することも出来る。 素、ヨウ素の何れでもよいが、好ましくは、塩素、臭素 である。また、前記したアルミニウム化合物は、ハロゲ ンを含有している化合物であってよい。

【0042】ハロゲン含有化合物としては、金属ハロゲ ン化合物やハロゲン化炭化水素が挙げられ、金属ハロゲ ン化合物には無機金属ハロゲン化合物や有機金属ハロゲ ン化合物が挙げられ、また、ハロゲン化炭化水素には、 鎖状ハロゲン化炭化水素、環状炭化水素、ハロゲン化芳 香族炭化水素等があげられる。

化スカンシウム、塩化イットリウム、塩化ランタン、四 塩化チタン、四塩化ジルコニウム、四塩化ハフニウム、 三塩化ホウ素、塩化アルミニウム、ジエチルアルミニウ ムクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、エチ ルアルミニウムジクロリド、塩化ガリウム、四塩化炭 素、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、ト リクロロエタン、テトタクロロエタン、ヘキサクロロシ クロヘキサン、ヘキサクロロベンゼン、1、3、5トリ クロロベンゼン、トリチルクロリド、四塩化シラン、ト 10

*【化11】

$$R^{13}$$
 $R^{15} M^{6} R^{14}$... (5)

【0038】一般式(4)及び(5)中、M⁵及びM⁶ ばれる金属元素であり、R®~R15は、有機基、無機基 または陰性原子を表し、[L] + は、周期律表の IA、 VIIA、VIII、IB及びIII B~VIB族から選ばれ る元素を含むカチオンを表す。

[0039]

【化12】

ズ、トリブチルスズクロリド、ジブチルスズジクロリ ド、ジブチルスズジブロミド、三塩化リン、三塩化アン 化アンチモン、三塩化ビスマス、三臭化ホウ素、三塩化 アルミニウム、四臭化炭素、ブロモホルム、ジブロモメ タン、ペンチルブロミド、ブロモベンゼン、ヨードメタ ン、四臭化ケイ素、ヘキサフルオロベンゼン、フッ化ア ルミニウム、スズトリフルオロメタンスルホネート、ト リメチルシリルトリフルオロメタンスルホネート、t-ブチルジメチルトリフルオロメタンスルホネート等が挙 げられる。これらの中では、液状の化合物は溶媒として 使用してもよく、また、これらは、単独で使用する他、

【0044】第4成分として使用される一般式(4)又 は(5)で表される化合物は、非配位性のルイス酸を含 む化合物を意味し、以下「化合物(A)又は(B)」を 以て表すこととする。一般式中、M⁵ 及びM⁶ は、周期 律表のIIIB族、IVB族、VB族およびVIB族か ら選ばれる元素であり、M® 及びM® としては、特に、 B、A1、In等が好適に使用される。

【0045】R⁹~R¹⁵は、有機基、無機基または陰性 原子であり、水素原子、ジアルキルアミノ基、炭素数1 【0043】ハロゲン含有化合物の具体例としては、塩 $40\sim20$ のアルコキシ基、炭素数 $6\sim20$ のアリールオキ シ基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20の アリール基、アルキルアリール基、アリールアルキル 基、炭素数1~20のハロゲン置換炭化水素基、炭素数 1~20のアシルオキシ基、炭素数1~20のアルコキ シアリール基、炭素数1~20のハロゲン置換アルコキ シアリール基、有機メタロイド基またはハロゲン原子な どから選ばれ、その2つ以上が互いに結合して環を形成 していてもよい。

【0046】R⁹~R¹⁵としては、具体的には、ジメチ リメチルクロロシラン、四塩化ゲルマニウム、四塩化ス 50 ルアミノ基、ジエチルアミノ基、ピロリル基、2,5-

ジメチルピロリル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプ ロポキシ基、n-ブトキシ基、t-ブトキシ基、フェノ キシ基、2,6-ジメチルフェノキシ基、2,6-t-ブチルフェノキシ基、ナフチルフェノキシ基、メチル 基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-オ クチル基、フェニル基、3-メチルフェニル基、2,4 - ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、 3,5-ジメチルフェニル基、2,3-ジメチルフェニ ル基、2, 4, 6-トリメチルフェニル基、2, 3, 5 ートリメチルフェニル基、2,3,4-トリメチルフェ 10 オクチル基、シクロヘキシル基、フェニル基、ベンジル ニル基、3-t-ブチルフェニル基、2,6-ジ-t-ブチルフェニル基、ベンジル基、p-フルオロフェニル 基、3、5-ジフルオロフェニル基、ペンタクロロフェ ニル基、3、4、5-トリフルオロフェニル基、ペンタ フルオロフェニル基、3,5-ジ(トリフルオロメチ ル)フェニル基、3-メトキシフェニル基、2,4-ジ メトキシフェニル基、2,6-ジメトキシフェニル基、 3,5-ジメトキシフェニル基、2,3-ジメトキシフ ェニル基、2,4,6-トリメトキシフェニル基、2, 3, 5-トリメトキシフェニル基、2, 3, 4-トリメ 20 トキシフェニル基、3, 5 - ビス (1 - メトキシ - 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エ チル)フェニル基、3-(1-メトキシ-2, 2, 2-トリフルオロー1ー (トリフルオロメチル) エチル) ー 5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-(2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 2, 2-トリフルオ ロエトキシ) -1- (トリフルオロメチル) エチル) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3、5-ビス (2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 2, 2-トリ チル)フェニル基、トリメチルシリル基、トリメチルゲ ルミル基、ジフェニルアルシン基、ジシクロヘキシルア ンチモン基、ペンタフルオロテルルオキシ基、F、C 1、Br、I等が挙げられる。

【0047】一般式(4)中、[L] + は、周期律表の IA族、VIIA族、VIII族、IB族およびIII B族~VIB族から選ばれる元素を含むカチオンを示 す。Lは、M⁷、M⁸ R²¹R²²、E¹ R²⁸R²⁴R²⁵又は E^2 R^{26} R^{27} R^{28} R^{29} で表されるものであり、 M^7 は、 周期律表のI族、IB族およびIIIB族から選ばれる元 40 素、M®は、VIIA族およびVIII族から選ばれる元 素、E¹ は、炭素原子、酸素原子または硫黄原子、E² は、窒素原子またはリン原子を示す。M⁷ としては、特 に、Li、Na、K、Ag等、M⁸ としては、特に、M n、Fe、Co、Niが好適である。

【0048】R²¹及びR²²は、シクロペンタジエニル 基、置換シクロペンタジエニル基、インデニル基または フルオレニル基から選ばれる置換基であり、互いに結合 して環を形成していてもよい。R²¹及びR²²の置換シク 12

のアルキル基であり、置換基の数は1~5の整数であ る。R²¹及びR²²の具体例としては、メチルシクロペン タジエニル基、n-ブチルシクロペンタジエニル基、ペ ンタメチルシクロペンタジエニル基などが挙げられる。 【0049】R²³~R²⁹は、水素原子、ハロゲン原子、 炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリー ル基、アルキルアリール基、アリールアルキル基または 有機メタロイド基から選ばれ、具体的には、水素、メチ ル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-基、3-メチルフェニル基、2、4-ジメチルフェニル 基、2、6-ジメチルフェニル基、3、5-ジメチルフ ェニル基、2、3-ジメチルフェニル基、2、4、6-トリメチルフェニル基、2、3、5-トリメチルフェニ ル基、2、3、4-トリメチルフェニル基、3-t-ブ

【0050】化合物(A)又は(B)の中では、M⁵又 はM⁶ がホウ素である化合物が特に好ましく、化合物 (A) の中では、具体的には、下記の化合物が特に好ま LU

チルフェニル基、2,6-ジ-t-ブチルフェニル基、

F、C1、Br、I等が挙げられる。

【0051】LがM⁷の化合物としては、テトラフェニ ルボレート銀、テトラフェニルボレートナトリウム、テ トラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート銀、テト ラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートリチウム、 テトラキス (ペンタフルオロテルルオキシ) ボレート 銀、テトラフルオロボレート銀、テトラフルオロヒ素酸 銀、テトラフルオロアンチモン酸銀等が好適である。

【0052】LがM⁸ R²¹ R²² の化合物としては、テト フルオロエトキシ)) -1- (トリフルオロメチル) エ 30 ラフェニルボレートフェロセニウム、テトラフェニルボ レートマンガン (テトラフェニルポルフィリン)、テト ラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートフェロセニ ウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート デカメチルフェロセニウム、テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル) ボレートアセチルフェロセニウム、テトラ キス (ペンタフルオロフェニル) ボレートホルミルフェ ロセニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボ レートシアノフェロセニウム等が好適である。

> 【0053】LがE¹ R²³ R²⁴ R²⁵ の化合物としては、 テトラフェニルボレートトリチル、テトラキス(ペンタ フルオロフェニル) ボレートトリチル、テトラフェニル ボレートメチルスルホニウム、テトラフェニルボレート ベンジルジメチルスルホニウム、テトラキス(ペンタフ ルオロフェニル) ボレートベンジルジメチルスルホニウ ム等が好適である。

【0054】LがE² R²⁶ R²⁷ R²⁸ R²⁹ の化合物として は、テトラフェニルボレートアンモニウム、テトラフェ ニルボレートトリエチルアンモニウム、テトラフェニル ボレートトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェ ロペンタジエニル基の置換基は、通常、炭素数が1~6 50 ニルボレートトリメチルアンモニウム、テトラフェニル

ボレートピロリニウム、テトラフェニルボレート2,5 - ジメチルピロリニウム、テトラキス (ペンタフルオロ フェニル)ボレートアンモニウム、テトラキス(ペンタ フルオロフェニル) ボレートトリエチルアンモニウム、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラキス (ペンタフル オロフェニル) ボレートトリメチルアンモニウム、テト ラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートアニリニウ ム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートモ ノメチルアニリニウム、テトラキス(ペンタフルオロフ 10 ボレートベンジルピリジニウム、テトラフェニルボレー ェニル) ボレートジメチルアニリニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートテトラフェニルホ スホニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボ レートテトラブチルアンモニウム、テトラキス(ペンタ フルオロフェニル) ボレートメチルジフェニルアンモニ ウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート トリフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル) ボレートピリジニウム、テトラキス (ペン タフルオロフェニル) ボレートジメチル (m-ニトロア ニリニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) 20 ボレートジメチル (p-ブロモアニリニウム)、テトラ キス (ペンタフルオロフェニル) ボレート (p-シアノ ピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル) ボレートトリメチルアニリニウム、テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル) ボレート (N-メチルピリジウ ム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート トリメチルスルホニウム、テトラキス(ペンタフルオロ フェニル) ボレート (oーシアノーNーメチルピリジニ ウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレー トジメチルジフェニルアンモニウム、テトラキス(ペン 30 タフルオロフェニル) ボレート (p-シアノ-N-ベン ジルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェ ニル) ボレートメチルトリフェニルアンモニウム、テト ラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートピロリニウ ム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート 2, 5-ジメチルピロリニウム、テトラキス(3,5-ジ(トリフルオロメチル)フェニル)ボレートジメチル アニリニウム、ヘキサフルオロヒ素酸トリエチルアンモ ニウム、テトラキス(3,5-ビス(1-メトキシー 2. 2. 2-トリフルオロー1-(トリフルオロメチ ル) エチル)) フェニルボレートジメチルアニリニウ ム、テトラキス(3-(1-メトキシ-2, 2, 2-ト リフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル)-5 - (トリフルオロメチル))フェニルボレートジメチル アニリニウム、テトラキス(3-(2,2,2-トリフ ルオロ-1-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-1-(トリフルオロメチル)エチル)-5-(トリフル オロメチル)) フェニルボレートジメチルアニリニウ ム、テトラキス(3、5-ビス(2、2、2-トリフル

14

- (トリフルオロメチル) エチル) フェニルボレートジ メチルアニリニウム、テトラフェニルボレートテトラエ チルアンモニウム、テトラフェニルボレートメチルトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェニルボレート ベンジルトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェ ニルボレートトリメチルアニリニウム、テトラフェニル ボレートジメチルジフェニルアンモニウム、テトラフェ ニルボレートメチルトリフェニルアンモニウム、テトラ フェニルボレートメチルピリジニウム、テトラフェニル トメチル(2-シアノピリジニウム)、テトラキス(ペ ンタフルオロフェニル) ボレート (テトラエチルアンモ ニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレ ート (メチルトリ (n-ブチル) アンモニウム)、テト ラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート (ベンジル トリ(n-ブチル)アンモニウム)、テトラキス(ペン タフルオロフェニル) ボレートメチル (4-シアノピリ ジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボ レートベンジルピリジニウム等が好適である。

【0055】化合物(B)の中では、具体的には、トリ ス(ペンタフルオロフェニル) ホウ素、トリス(3,5 -ビス(1-メトキシ-2,2,2-トリフルオロ-1 - (トリフルオロメチル) エチル)) フェニルホウ素、 トリス3-(1-メトキシ-2, 2, 2-トリフルオロ -1-(トリフルオロメチル)エチル)-5-(トリフ ルオロメチル)) フェニルホウ素、トリス(3-(2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 2, 2-トリフルオ ロエトキシ) -1- (トリフルオロメチル) エチル) -5-(トリフルオロメチル))フェニルホウ素、トリス (3, 5-ビス(2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 2, 2- トリフルオロエトキシ) - 1 - (トリフルオロメチル)エチル)フェニルホウ素、トリフェニル ホウ素、トリス(ペンタフルオロテルルオキシ)ホウ素 などが特に好ましい。

【0056】第4成分として用いられる一般式(6)で 表される化合物として、メタノール、エタノール、プロ パノール、プロペノール、プロピノール、2-プロパノ ール、2-エチルヘキサノール、シクロヘキサノール、 エチレングリコール、トリエチレングリコール、ベンジ 40 ルアルコール、1-フェニルエタノール、1-フェニル プロパノール、シンナムアルコール、トリフルオロメタ ノール、ビストリフルオロメチルメタノール等のアルコ ール類、フェノール、ジt-ブチルフェノール、カテコ ール等のフェノール類、酢酸、酪酸、シュウ酸、安息香 酸などのカルボン酸類、p-トルエンスルホン酸、メタ ンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸などのス ルホン酸類などが挙げられる。これらの中では、スルホ ン酸類が好ましく、トリフルオロメタンスルホン酸が特 に好ましい。

オロ-1-(2, 2, 2-1)フルオロエトキシ) -1 50 【0057】本発明においては、上記の各触媒成分から

成る触媒系を使用して溶液中でα-オレフインの低重合を行なう。各触媒成分とα-オレフインとの接触態様は、特には限定されないが、次のような接触態様が好ましい。

【0058】1)酸アミド又はイミド化合物および金属 アルキル化合物を含む溶液中にαーオレフイン及びクロ ム化合物を導入する方法。

- 2) クロム化合物および酸アミド又はイミド化合物を含む溶液中に α オレフイン及び金属アルキル化合物を導入する方法。
- 3) クロム化合物および金属アルキルを含む溶液中にαーオレフイン及び酸アミド又はイミド化合物を導入する方法。
- 4) クロム化合物を含む溶液中にαーオレフイン、酸アミド又はイミド化合物および金属アルキル化合物を導入する方法。
- 5) 金属アルキル化合物を含む溶液中にαーオレフイン、クロム化合物および酸アミド又はイミド化合物を導入する方法。
- 6)酸アミド又はイミド化合物を含む溶液中にα-オレ 20 フイン、クロム化合物および金属アルキル化合物を導入する方法。
- 7) クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物、金属アルキル化合物を含む溶液中にα-オレフインを導入する 方法
- 8) クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物、金属アルキル化合物およびα-オレフインをそれぞれ同時かつ独立に反応器に導入する方法。
- 【0059】また、溶媒中に各成分を独立に又は予め適 レフイン、クロム化合に 宜混合した混合物を供給して反応を行ってもよい。例え 30 化合物を導入する方法。 ば、次の態様が挙げられる。 13) クロム化合物、
- 【0060】1)溶媒中にクロム化合物、酸アミド又は イミド化合物、金属アルキルおよびαーオレフインを独 立に同時に供給する方法。
- 2) 溶媒中にクロム化合物、酸アミド又はイミド化合物 と金属アルキルの混合物およびαーオレフインを独立に 同時に供給する方法。
- 3) 溶媒中にクロム化合物と酸アミド又はイミド化合物 の混合物、金属アルキル及び α オレフインを独立に同時に供給する方法。

【0061】また、ハロゲン含有化合物や一般式(4)~(6)で表される化合物などを第4成分と表現した場合は、各触媒成分とα-オレフインとの次の様な接触態様が例示される。

【0062】1)酸アミド又はイミド化合物、第4成分 および金属アルキル化合物を含む溶液中にα-オレフイ ン及びクロム化合物を導入する方法。

2)酸アミド又はイミド化合物および金属アルキル化合物を含む溶液中にαーオレフイン、第4成分およびクロム化合物を導入する方法。

16

- 3) クロム化合物、第4成分および酸アミド又はイミド 化合物を含む溶液中に α -オレフイン及び金属アルキル 化合物を導入する方法。
- 4) クロム化合物および酸アミド又はイミド化合物を含む溶液中に α オレフイン、第4成分および金属アルキル化合物を導入する方法。
- 5) クロム化合物、第4成分および金属アルキルを含む 溶液中に α オレフイン及び酸アミド又はイミド化合物 を導入する方法。
- 10 6) クロム化合物および金属アルキルを含む溶液中に α ーオレフイン、第4成分および酸アミド又はイミド化合物を導入する方法。
 - 7) クロム化合物および第4成分を含む溶液中に α -オレフイン、酸アミド又はイミド化合物および金属アルキル化合物を導入する方法。
 - 8) クロム化合物を含む溶液中に-オレフイン、酸アミド又はイミド化合物、第4成分および金属アルキル化合物を導入する方法。
 - 9) 金属アルキル化合物および第4成分を含む溶液中に αーオレフイン、クロム化合物、及び酸アミド又はイミ ド化合物を導入する方法。
 - 10) 金属アルキル化合物を含む溶液中に α オレフイン、クロム化合物、第4成分および酸アミド又はイミド化合物を導入する方法。
 - 11)酸アミド又はイミド化合物および第4成分を含む溶液中にα-オレフイン、クロム化合物および金属アルキル化合物を導入する方法。
 - 12)酸アミド又はイミド化合物を含む溶液中に α -オレフイン、クロム化合物、第4成分および金属アルキル化合物を導入する方法。
 - 13) クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物、金属アルキル化合物および第4成分を含む溶液中に α オレフインを導入する方法。
 - 14) クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物、金属 アルキル化合物を含む溶液中に α – オレフインおよび第 4成分を導入する方法。
 - 15)第4成分を含む溶液中にクロム化合物、酸アミド 又はイミド化合物、金属アルキル化合物および α - オレ フインを導入する方法。
- #0 16)クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物、金属アルキル化合物、第4成分およびα-オレフインをそれぞれ同時かつ独立に反応器に導入する方法。

【0063】そして、上記の各溶液は、通常、反応溶媒を使用して調製される。2種以上の金属アルキル化合物の混合物を使用する場合や2種以上の溶媒を混合して使用する場合は、その混合される各々の成分は、予め混合されていてもよいが、必ずしもその必要はなく、別々に反応器に導入することも可能である。

【0064】また、溶媒中に各成分を独立に又は予め適 50 宜混合した混合物を供給して反応を行ってもよい。例え

ば、次の様な態様が挙げられる。

【0065】1)溶媒中にクロム化合物、酸アミド又は イミド化合物、金属アルキル、第4成分およびα-オレ フインを独立に同時に供給する方法。

- 2) 溶媒中にクロム化合物、酸アミド又はイミド化合物 と金属アルキルの混合物、第4成分およびα-オレフイ ンを独立に同時に供給する方法。
- 3)溶媒中にクロム化合物と酸アミド又はイミド化合物 の混合物、金属アルキル、第4成分およびα-オレフイ ンを独立に同時に供給する方法。
- 4)溶媒中にクロム化合物と第4成分の混合物、酸アミ ド又はイミド化合物の混合物、金属アルキル及びα-オ レフインを独立に同時に供給する方法。
- 5)溶媒中にクロム化合物、酸アミド又はイミド化合物 の混合物、金属アルキルと第4成分の混合物およびα-オレフインを独立に同時に供給する方法。

【0066】本発明において、原料α-オレフインとし ては、炭素数が $2\sim30$ の置換または非置換の α -オレ フインが使用される。具体的には、エチレン、プロピレ チルー1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン等が挙げ られる。特に、原料 α - オレフインとしてエチレンが好 適であり、エチレンからその三量体である1-ヘキセン を高収率かつ高選択率で得ることが出来る。

【0067】本発明において、反応溶媒としては、ブタ ン、ペンタン、3-メチルペンタン、ヘキサン、ヘプタ ン、2-メチルヘキサン、オクタン、シクロヘキサン、 メチルシクロヘキサン、2,2,4-トリメチルペンタ ン、デカリン等の炭素数1~20の鎖状または脂環式の 飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル 30 ベンゼン、メシチレン、テトラリン等の芳香族炭化水素 などが使用される。これらは、単独で使用する他、混合 溶媒として使用することも出来る。

【0068】また、反応溶媒として、反応原料のα-オ レフインそれ自体または主原料以外のα-オレフインを 使用することも出来る。反応溶媒用としては、炭素数が 4~30のα-オレフインが使用されるが、常温で液状 $O(\alpha)$ - オレフインが特に好ましい。

【0069】特に、反応溶媒としては、炭素数が4~1 0の鎖状飽和炭化水素または脂環式飽和炭化水素が好ま 40 しい。これらの溶媒を使用することにより、ポリマーの 副生を抑制することが出来、更に、脂環式炭化水素を使 用した場合は、高い触媒活性が得られると言う利点があ る。

【0070】本発明において、クロム化合物の使用量 は、溶媒1リットル当たり、通常1. $0 \times 10^{-7} \sim 0$. 5 mo 1、好ましくは 1. $0 \times 10^{-6} \sim 0$. 2 mo 1、 更に好ましくは1. 0×10⁻⁵~0. 05molの範囲 とされる。一方、金属アルキル化合物の使用量は、クロ ム化合物 1 m o 1 当たり、通常 5 0 m m o 1 以上である 50 18

が、触媒活性および三量体の選択率の観点から、0.1 mo1以上とするのがよい。そして、上限は、通常1. $0 \times 10^4 \text{ mol}$ である。また、酸アミド及びイミド化 合物の使用量は、クロム化合物 1 mo 1 当たり、通常 0.001mo1以上であり、好ましくは0.005~ 1000mo1、更に好ましくは0.01~100mo 1の範囲とされる。また、第4成分として使用されるハ ロゲン含有化合物および前記一般式(4)~(6)で表 される化合物の使用量は、クロム化合物1mo1当た 10 り、通常 0.001 mo 1以上であり、好ましくは 0. 01mol以上である。そして、その上限は、特に制限 されないが、通常1. 0×104mo1である。

【0071】本発明においては、クロム化合物(a)、 酸アミド又はイミド化合物(b)及び金属アルキル化合 物(c)、び第4成分として使用されるハロゲン含有化 合物および前記一般式(4)~(6)で表される化合物 (d) のモル比(a):(b):(c):(d)は1: 0. 1~10:1~100:0. 1~20が好ましく、 1:1~5:5~50:1~10が特に好ましい。斯か ン、1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテン、3-メ 20 る特定条件の結合により、 $\alpha-$ オレフイン低重合体とし て、例えば、ヘキセンを90%以上(全生成量に対する 割合)の収率で製造することが出来、しかも、ヘキセン 中の1-ヘキセンの純度を99%以上に高めることが出 来る。

> 【0072】反応温度は、通常0~250℃、好ましく は0~150°C、更に好ましくは20~130°Cであ る。一方、反応圧力は、常圧ないし250kg/cm² の範囲から選択し得るが、通常は、 $100 \,\mathrm{kg/c}\,\mathrm{m}^2$ の圧力で十分である。そして、滞留時間は、通常1分か ら20時間、好ましくは0.5~6時間の範囲とされ る。また、反応形式は、回分式、半回分式または連続式 の何れであってもよい。そして、反応時に水素を共存さ せるならば、触媒活性および三量体の選択率の向上が認 められるので好ましい。また、水素の共存により、副生 するポリマーの性状が付着性の少ない紛状となる効果も 得られる。共存させる水素の量は、水素分圧として、通 常0. $1\sim100$ kg/c m^2 、好ましくは1. $0\sim8$ 0 k g/c m2 の範囲とされる。

> 【0073】反応液中の副生ポリマーの分離除去は、公 知の固液分離装置を適宜使用して行われ、回収されたα - オレフイン低重合体は、必要に応じて精製される。精 製には、通常、蒸留精製が採用され、目的とする成分を 高純度で回収することが出来る。本発明においては、特 に、エチレンから高純度の1-ヘキセンを工業的有利に 製造することが出来る。そして、公知の重合触媒を使用 した重合反応により、本発明の製造方法で得られた1-ヘキセンから有用な樹脂であるL-LDPEを製造する ことが出来る。

[0074]

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例により更

に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限 り以下の実施例に限定されるものではない。なお、反応 条件は、表2~7にまとめて示した。また、反応結果 は、表8~18にまとめた示した。反応時間は、全て 0.5時間とした。

【0075】実施例1

120℃の乾燥器で加熱乾燥した300m1のオートク レーブを熱時に組み立て、真空窒素置換した。このオー トクレーブには破裂板を備えた触媒成分フィード管を取 り付けておいた。シクロヘキサン(120m1)、マレ10 実施例1において、マレイミドの代わりに、3、4 - ジ イミド(0.156mmol)のヘプタン溶液およびト リエチルアルミニウム (0.779mmo1) のn-へ プタン溶液をオートクレーブ胴側に仕込み、一方、触媒 成分フィード管にクロム(III)2-エチルヘキサノ エート (25mg、0.052mmo1) のn-ヘプタ ン溶液を仕込んだ。n-ヘプタンの全体量は5m1であ った。この時点では、クロム化合物とトリエチルアルミ ニウムは接触していない。

【0076】先ず、オートクレーブを80℃に加熱し、 次いで、80℃でエチレンを触媒成分フィード管より導 20 た。 入した。エチレン圧により破裂板が破裂し、クロム化合 物がオートクレーブ胴側に導入されエチレンの低重合が 開始された。エチレンを全圧が35kg/cm² Gにな るまで導入し、以後、全圧を35kg/cm² Gに、反 応温度を80℃に維持した。0.5時間後、オートクレ ーブ中にエタノール圧入して反応を停止した。オートク レーブの圧力を解除して脱ガスを行った後、濾過機によ って反応液中の副生ポリマー(主としてポリエチレン) を分離除去してα-オレフイン低重合体を回収した。ガ 分析を行った。

【0077】実施例2

実施例1において、溶媒量と触媒成分仕込量を変更し た。すなわち、シクロヘキサン(48m1)、マレイミ ド(0.062mmol)トリエチルアルミニウム (0.311mmol)、クロム(III) 2-エチル ヘキサノエート (10mg、0.021mmo1)、n -ヘプタン(2m1)を使用した他は、実施例1記載の 方法で反応を行った。

【0078】実施例3

実施例1において、触媒成分の仕込場所を変更した。す なわち、シクロヘキサン、マレイミドのn-ヘプタン溶 液およびクロム (III) 2-エチルヘキサノエートの n-ヘプタン溶液をオートクレーブ胴側に、一方、トリ エチルアルミニウムのn-ヘプタン溶液を触媒成分フィ ード管に仕込んだ他は、実施例1記載の方法で反応を行 った。

【0079】実施例4

実施例2において、トリエチルアルミニウム(0.31

20

ルアルミニウム(0.311mmo1)のn-ヘプタン 溶液およびエチルアルミニウムジクロリド(0.042 mmo1)のn-ヘプタン溶液を使用した他は、実施例 2記載の方法で反応を行った。

【0080】実施例5

実施例1において、マレイミドの代わりに、3-メチル マレイミドを使用した他は、実施例1記載の方法で反応 を行った。

【0081】実施例6

メチルマレイミドを使用した他は、実施例1記載の方法 で反応を行った。

【0082】実施例7

実施例2において、マレイミドの代わりに3、4-ジク ロロマレイミドを使用した他は、実施例2記載の方法で 反応を行った。

【0083】実施例8

実施例1において、マレイミドの代わりに、マレイミド 銀塩を使用した他は、実施例1記載の方法で反応を行っ

【0084】実施例9

実施例3において、マレイミドの代わりに、マレイミド 銀塩を使用した他は、実施例3記載の方法で反応を行っ

【0085】実施例10

実施例4において、マレイミドの代わりに、3,4-ジ メチルマレイミドを使用した他は、実施例4記載の方法 で反応を行った。

【0086】実施例11

スクロマトグラフによる α -オレフイン低重合体の組成 30 実施例4において、マレイミドの代わりに、3 , 4 - ジ クロロマレイミドを使用した他は、実施例4記載の方法 で反応を行った。

【0087】実施例12

実施例1において、シクロヘキサン(55m1)、マレ イミド(0.078mmol)、トリアルキルアルミニ ウム (0. 390mmo1)、クロム (III) 2-エ チルヘキサノエト (12.5mg, 0.026mmo 1)、n-ヘプタン(5m1)を使用し、トリアルキル アルミニウムとしてトリイソブチルアルミニウムを使用 40 した他は、実施例1記載の方法で反応を行った。

【0088】実施例13

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジエチルアルミニウムクロリドを使用した他 は、実施例4記載の方法で反応を行った。

【0089】実施例14

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、セスキアルミニウムクロリドを使用した他は、 実施例4記載の方法で反応を行った。

【0090】実施例15

ンを使用した他は、実施例2記載の方法で反応を行っ た。

【0091】実施例16

実施例1において、シクロヘキサン(120m1)の代 わりに、シクロヘキサン(120m1)及びトルエン (2.5m1)を使用した他は、実施例1記載の方法で 反応を行った。

【0092】実施例17

実施例4において、シクロヘキサン(48m1)の代わ りに、シクロヘキサン (48m1) 及びトルエン (1m 10 1)を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ

【0093】実施例18

実施例1において、シクロヘキサン(120m1)の代 わりに、シクロヘキサン(120m1)及びクロロホル ム(0.5m1)を使用した他は、実施例1記載の方法 で反応を行った。

【0094】実施例19

実施例1において、シクロヘキサン(120m1)の代 わりに、シクロヘキサン(120ml)及びジクロロメ 20 タン(0.3ml)を使用した他は、実施例1記載の方 法で反応を行った。

【0095】実施例20

実施例1において、シクロヘキサン(120m1)の代 わりに、シクロヘキサン(120ml)及びジクロロメ タン(1.55m1)を使用した他は、実施例1記載の 方法で反応を行った。

【0096】実施例21

実施例1において触媒成分仕込量を変更した。すなわ ち、マレイミド (0.039 mm o 1) 、トリエチルア 30 ルミニウム (0. 195mmol)、クロム (III) 2-エチルヘキサノエート(6.3mg、0.013m mo1)を使用した他は、実施例1記載の方法で反応を 行った。

【0097】実施例22

実施例4において溶媒量と触媒仕込量を変更した。すな わち、シクロヘキサン(120m1)、マレイミド (0. 156mmol、トリエチルアルミニウム(0. 779mmo1)、エチルアルミニウムジクロリド (0.104mmol)、クロム(III) 2-エチル 40 ヘキサノエート (2. 5 mg、0. 0052 mmo 1)、n-ヘプタン(5m1)を使用した他は、実施例 4記載の方法で反応を行った。

【0098】実施例23

実施例1において、トリエチルアルミニウムの仕込量を 3. 11mmo1に変更した他は、実施例1記載の方法 で反応を行った。

【0099】実施例24

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの仕 込量を0.073mmo1に変更した他は、実施例4記 50 実施例1と同様にして、マレイミド、トエチルアルミニ

22

載の方法で反応を行った。 【0100】実施例25

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの仕 込量を0.208mmo1に変更した他は、実施例4記 載の方法で反応を行った。

【0101】実施例26

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの仕 込量を0.126mmo1に変更した他は、実施例4記 載の方法で反応を行った。

【0102】実施例27

実施例4において、トリエチルアルミニウムの仕込量を 0. 934mmo1に変更した他は、実施例4記載の方 法で反応を行った。

【0103】実施例28

実施例4において、触媒仕込量を変更した。すなわち、 マレイミド(0.108mmol)、トリエチルアルミ ニウム(0.42mmol)、エチルアルミニウムジク ロリド(0.062mmol)を使用した他は、実施例 4記載の方法で反応を行った。

【0104】実施例29

実施例1において、マレイミドの仕込量を0.052m molに変更した他は、実施例1記載の方法で反応を行 った。

【0105】実施例30

実施例1において、マレイミドの仕込量を0.260m molに変更した他は、実施例1記載の方法で反応を行 った。

【0106】実施例31

実施例1において、エチレン導入時のオートクレーブの 温度および反応温度を115℃に変更する他は、実施例 1記載の方法で反応を行った。

【0107】実施例32

実施例3において、エチレン導入時のオートクレーブの 温度および反応温度を115℃に変更する他は、実施例 3記載の方法で反応を行った。

【0108】実施例33

実施例22において、クロム(III)2-エチルヘキ サノエート (25mg、0.052mmo1) を使用 し、エチレン導入時のオートクレーブの温度と反応温度 を50℃に変更し、反応時の圧力を20kg/cm² G に変更する他は、実施例22記載の方法で反応を行っ た。

【0109】実施例34

【0111】実施例36

実施例1において、反応時の全圧を60kg/cm2 G に変更する他は、実施例1記載の方法で反応を行った。 【0110】実施例35

実施例1において、反応時の全圧を $20 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ に変更する他は、実施例1記載の方法で反応を行った。

ウム、クロム(III) (2-エチルヘサノエート)を オートクレーブに仕込んだ。水素を3.5 kg/cm² 導入し、オートクレーブを80℃に加熱した。80℃で エチレンを触媒成分フィード管より全圧が38.5kg /cm² Gになるまで導入し、以後、80℃、38.5 kg/cm² Gを維持して反応を行った

【0112】実施例37

実施例36において、水素の仕込み圧を7kg/cm 2、反応時の全圧を42kg/cm2Gに変更する他 は、実施例36記載の方法で反応を行った。

【0113】実施例38

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、四塩化スズ(0.032mmo1)を使用した 他は、実施例4記載の方法で反応を行った。

【0114】実施例39

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジブチルチンジクロリド(0.063mmo 1)を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ た。

【0115】実施例40

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジブチルチンジブロミド(0.084mmo 1)を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ

【0116】実施例41

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジブチルチンジブロミド(0.021mmo 1)を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ た。

【0117】実施例42

実施例33において、エチルアルミニウムジクロリドの 代わりに、四塩化炭素(0.104mmol)を使用 し、反応温度を80℃とした他は、実施例33記載の方 法で反応を行った。

【0118】実施例43

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、テトラクロロエタン(0.062mmo1)を 使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行った。

【0119】実施例44

メタン (23.4mmo1) を使用した他は、実施例4 記載の方法で反応を行った。

【0120】実施例45

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、四臭化炭素 (0.084mmo1) を使用した 他は、実施例4記載の方法で反応を行った。

【0121】実施例46

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジブロモメタン(0.084mmol)を使用 した他は、実施例4記載の方法で反応を行った。

24

【0122】実施例47

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ペンチルブロミド(0.084mmol)を使 用した他は、実施例4記載の方法で反応を行った。

【0123】実施例48

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジブチルチンジクロリド(0.084mmo

- 1) 及びジブチルチンジブロミド(0.021mmo
- 1)を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ 10 た。

【0124】実施例49

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジブチルチンジクロリド(0.062mmo 1) 及びジブチルチンジブロミド(0,010mmo 1)を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ た。

【0125】実施例50

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジブチルチンジクロリド(0.062mmo

- 20 1) 及びジブチルチンジブロミド(0.002mmo
 - 1)を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ

【0126】実施例51

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、ジエチルアルミニウムクロリド(0.168m mo1) 及び四臭化炭素 (0.042mmo1) を使用 した他は、実施例4記載の方法で反応を行った。

【0127】実施例52

実施例42において、四塩化炭素の代わりに、t-ブチ 30 ルジメチルシリルトリフラート(0.26mmol)を 使用した他は、実施例42記載の方法で反応を行った。

【0128】実施例53

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、トリスペンタフルオロフェニルボラン(0.0 42mmo1)を使用した他は、実施例4記載の方法で 反応を行った。

【0129】実施例54

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、別容器にてn-ヘプタン中でトリフルオロメタ 実施例42において、四塩化炭素の代わりに、ジクロロ *40* ンスルホン酸(0.126mmo1)とトリエチルアル ミニウム (0. 125mmol) を混合して反応させた 溶液を使用した他は、実施例4記載の方法で反応を行っ

【0130】実施例55

実施例54において、別容器で混合して反応させる触媒 成分の仕込量をトリフルオロメタンスルホン酸(0.4) 15 mm o 1)、トリエチルアルミニウム(0.411 mmo1)に変更した他は、実施例54記載の方法で反 応した。

50 【0131】実施例56

実施例54において、別容器で混合して反応させる触媒 成分の仕込量をトリフルオロメタンスルホン酸(1.2) 46 mm o 1)、トリエチルアルミニウム(0.411 mmo1)に変更した他は、実施例54記載の方法で反 応した。

【0132】実施例57

実施例54において、トリフルオロメタンスルホン酸の 代わりに、エタノールを使用した他は、実施例54記載 の方法で反応を行った。

【0133】実施例58

実施例42において、四塩化炭素の代わりに、ビストリ フルオロメチルメタノール(0.104mmol)を使 用した他は、実施例42記載の方法で反応を行った。

【0134】実施例59

実施例4において、エチルアルミニウムジクロリドの代 わりに、2, 5-ジ-t-ブチルフェノール(0.10)4mmol)を使用した他は、実施例4記載の方法で反 応を行った。

【0135】実施例60

なわち、シクロヘキサン、クロム(III) 2-エチル ヘキサノエートのn-ヘプタン溶液、および、トリエチ ルアルミニウムのn-ヘプタン溶液をオートクレーブ胴 側に、一方、マレイミドのn-ヘプタン溶液を触媒成分 フィード管に変更した他は、実施例2記載の方法で反応 を行った。

【0136】実施例61

実施例2において、シクロヘキサン、クロム(III) 2-エチルヘキサノエートのn-ヘプタン溶液、トリエ ミドのn-ヘプタン溶液の全てをオートクレーブ胴側に 仕込んだ他は、実施例2記載の方法で反応を行った。

【0137】実施例62

実施例4において、触媒成分の仕込場所を変更した。す なわち、シクロヘキサン、マレイミドのn-ヘプタン溶 液、クロム (III) 2-エチルヘキサノエートのn-ヘプタン溶液、および、エチルアルミニウムジクロリド のn-ヘプタン溶液をオートクレーブ胴側に、一方、ト リエチルアルミニウムのn-ヘプタン溶液を触媒成分フ ィード管に変更した他は、実施例4記載の方法で反応を 40 【表1】 行った。

【0138】実施例63

実施例4において、触媒成分の仕込場所を変更した。す なわち、シクロヘキサン、マレイミドのn-ヘプタン溶 液、および、クロム(III)2-エチルヘキサノエー トのn-ヘプタン溶液をオートクレーブ胴側に、一方、 トリエチルアルミニウムのn-ヘプタン溶液、および、 エチルアルミニウムジクロリドのn-ヘプタン溶液を触 媒成分フィード管に変更した他は、実施例4記載の方法 で反応を行った。

26

10 【0139】実施例64

実施例4において、触媒成分の仕込場所を変更した。す なわち、シクロヘキサン、マレイミドのn-ヘプタン溶 液、および、トリエチルアルミニウムのn-ヘプタン溶 液をオートクレーブ胴側に、一方、クロム(III)2 -エチルヘキサノエートのn-ヘプタン溶液およびエチ ルアルミニウムジクロリドのn-ヘプタン溶液を触媒成 分フィード管に変更した他は、実施例4記載の方法で反 応を行った。

【0140】実施例65

実施例2において、触媒成分の仕込場所を変更した。す 20 実施例4において、触媒成分の仕込場所を変更した。す なわち、シクロヘキサン、クロム(III)2-エチル ヘキサノエートのn-ヘプタン溶液、および、トリエチ ルアルミニウムのn-ヘプタン溶液をオートクレーブ胴 側に、一方、マレイミドのn-ヘプタン溶液およびエチ ルアルミニウムジクロリドのn-ヘプタン溶液を触媒成 分フィード管に変更した他は、実施例4記載の方法で反 応を行った。

【0141】実施例66

実施例4において、触媒成分の仕込場所を変更した。す チルアルミニウムのn-ヘプタン溶液、および、マレイ 30 なわち、シクロヘキサン、クロム(III)2-エチル ヘキサノエートのn-ヘプタン溶液、トリエチルアルミ ニウムのn-ヘプタン溶液、エチルアルミニウムジクロ リドのn-ヘプタン溶液、および、マレイミドのn-ヘ プタン溶液の全てをオートクレーブ胴側に仕込んだ他 は、実施例4記載の方法で反応を行った。

> 【0142】表2~7中、溶媒種類の記号A~Iは次の 表1に示す溶媒を表す(CHX:シクロヘキサン、H $P: n- \wedge \mathcal{I} \neq \mathcal{I} \times TL: \wedge \mathcal{I} \times \mathcal{I} \times$

[0143]

A: CHX (120m1) + HP (5m1)

B: CHX (48m1) + HP (2m1)

C: HP

D: CHX (55m1) + HP (5m1)

E: CHX (120m1) + HP (5m1) + TL (2.5m1)

F: CHX (48m1) + HP (2m1) + TL (1m1)

 $G: CHX (120m1) + HP (5m1) + CHC1_3 (0.5m1)$

H: CHX (120ml) +HP (5ml) +CH2 Cl2 (0.30ml)

I:CHX (120m1) +HP (5m1) +CH₂ C1₂ (1.55m1)

【0144】また、表2~7中の「Cr (2EHA) 』」はクロム(III) 2-エチルヘキサノエート、「Et 8 A 1 」はトリエチルアルミニウムを表し、表8~18 中の「HX」は1-hexeneを表す。

【0145】また、表2~7中の接触方法の各記号は次 の態様を表す。

- a)酸アミド又はイミド化合物および金属アルキル化合 物(及び第4成分)を含む溶液中にα-オレフイン及び クロム化合物を導入する方法。
- む溶液中に α-オレフイン及び金属アルキル化合物を導
- c) クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物、金属ア ルキル化合物を含む溶液中に α-オレフインを導入する
- d) クロム化合物、金属アルキル及び酸アミド又はイミ ド化合物を含む溶液中に α - オレフインを導入する方 法。
- e) クロム化合物、第4成分および酸アミド又はイミド*

*化合物を含む溶液中にαーオレフイン及び金属アルキル 化合物を導入する方法。

- f) クロム化合物および酸アミド又はイミド化合物を含 む溶液中にα-オレフイン、第4成分および金属アルキ ル化合物を導入する方法。
- g)酸アミド又はイミド化合物および金属アルキル化合 物を含む溶液中にα-オレフイン、第4成分およびクロ ム化合物を導入する方法。
- h) クロム化合物および金属アルキルを含む溶液中に α b) クロム化合物および酸アミド又はイミド化合物を含 10 -オレフイン、第4成分および酸アミド又はイミド化合 物を導入する方法。
 - i) クロム化合物、酸アミド又はイミド化合物、金属ア ルキル化合物および第4成分含む溶液中にαーオレフイ ンを導入する方法。

【0146】また、表8~18中の触媒効率の単位はg $-\alpha$ -オレフイン/1g-クロム、触媒活性の単位はg $-\alpha - \lambda \sqrt{1} g - \alpha + Hr \cos \delta$.

[0147]

【表2】

	実施例								
	1	2	3	4	5	6			
溶媒種類	A	В	Α	В	A	A			
Cr (2EHA) 3 (mmol)	0.052	0.021	0.052	0.021	0.052	0.052			
マレイミド類(mmol)	0.156	0.062	0.156	0.062	0.156	0.156			
Eta Al (mmol)	0.779	0.311	0.779	0.311	0.779	0.779			
第4成分種類	_	_	_	(1)	_	_			
第4成分(mmol)	_	_	_	0.042	_	_			
接触方法	a	a	b	a	a	а			
反応温度(℃)	80	80	80	80	80	80			
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35	35	35			
	実施例								
	7	8	9	10	11	12			
溶媒種類	В	A	Α	В	В	D			
Cr(2EHA) ₃ (mmol)	0.021	0.052	0.052	0.021	0.021	0.026			
マレイミド類 (mmol)	0.062	0.156	0.156	0.062	0.062	0.078			
Et₃Al(mmol)	0.311	0.779	0.779	0.311	0.311	_			
第4成分種類	_	_	_	(1)	(1)	(2)			
第4成分(mmol)	_	_	_	0.042	0.042	0.390			
接触方法	a	a	b	a	a	a			
反応温度(℃)	80	80	80	80	80	80			
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35	35	35			
(注) (1) EtAlCl2	(2)	iBu3 Al							

[0148]

【表3】

	実施例						
	13	14	15	16	17	18	
溶媒種類	В	В	С	E	F	G	
Cr(2EHA)3 (mmol)	0.021	0.021	0.021	0.052	0.021	0.052	
マレイミド類 (mmol)	0.062	0.062	0.062	0.156	0.062	0.156	

特開平8-59732 (16)

29						<i>30</i>	
Et ₃ Al (mmol)	0.311	0.311	0.311	0.779	0.311	0.779	
第4成分種類	(3)	(4)	_	_	(1)	_	
第4成分 (mmol)	0.042	0.042	_	_	0.042	_	
接触方法	a	а	a	a	a	а	
反応温度 (℃)	80	80	80	80	80	80	
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35	35	35	
			実	施例			
	19	20	21	22	23	24	
溶媒種類	Н	I	Α	A	A	В	
Cr (2EHA) 3 (mmol)	0.052	0.052	0.013	0.0052	0.052	0.021	
マレイミド類(mmol)	0.156	0.156	0.039	0.156	0.156	0.062	
Et ₃ Al (mmol)	0.779	0.779	0.389	0.779	3. 110	0.311	
第4成分種類	_	_	_	(1)	_	(1)	
第4成分 (mmol)	_	_	_	0.104	_	0.073	
接触方法	a	а	a	a	a	а	
反応温度 (℃)	80	80	80	80	80	80	
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35	35	35	
(注) (3) · Ft。All	rı (4) • Ft.	AlaCla				

(注) (3) : Et2AlCl、(4) : Et3Al2Cl3

[0149] * *【表4】

	実施例								
	25	26	27	28	29	30			
溶媒種類	В	В	В	В	A	A			
Cr (2EHA) 3 (mmol)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.052	0.052			
マレイミド類(mmol)	0.062	0.062	0.062	0.108	0.052	0.260			
Et ₃ Al (mmol)	0.311	0.311	0.934	0.420	0.779	0.779			
第4成分種類	(1)	(1)	(1)	(1)	_	_			
第4成分(mmol)	0.208	0.126	0.042	0.062	_	_			
接触方法	a	a	a	a	a	a			
反応温度(℃)	80	80	80	80	80	80			
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35	35	35			
	実施例								
	31	32	33	34	35	36			
溶媒種類	A	A	Α	Α	A	A			
Cr(2EHA) ₃ (mmol)	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052			
マレイミド類 (mmol)	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156			
EtaAl (mmol)	0.779	0.779	0.779	0.779	0.779	0.779			
第4成分種類	_	_	(1)	_	_	_			
第4成分 (mmol)	_	_	0.104	_	_	_			
接触方法	a	b	a	a	a	a			
反応温度 (℃)	115	115	50	80	80	80			
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	60	20	38.5			
	【表 5 】								

[0150]

	実施例						
	37	38	39	40	41	42	
溶媒種類	A	В	В	В	В	Α	
Cr (2EHA) 3 (mmol)	0.052	0.021	0.021	0.021	0.021	0.052	
マレイミド類(mmol)	0.156	0.062	0.062	0.062	0.062	0.156	
Et ₃ Al (mmol)	0,779	0.311	0.311	0.311	0.311	0,779	

			, [,]	+ tal			
エチレン圧(Kg/cm²G)	42	35	35	35	35	35	
反応温度 (℃)	80	80	80	80	80	80	
接触方法	a	a	a	a	a	a	
第4成分 (mmol)	_	0.032	0.063	0.084	0.021	0.104	
第4成分種類	_	(5)	(6)	(13)	(13)	(7)	
31						32	

=								
	43	44	45	46	47	48		
溶媒種類	В	A	В	В	В	В		
Cr (2EHA) 3 (mmol)	0.021	0.052	0.021	0.021	0.021	0.021		
マレイミド類(mmol)	0.062	0.156	0.062	0.062	0.062	0.062		
EtsAl (mmol)	0.311	0.779	0.311	0.311	0.311	0.311		
第4成分種類	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(6)		
第4成分 (mmol)	0.062	23.4	0.084	0.084	0.084	0.084		
第4成分種類	_	_	_	_	_	(13)		
第4成分 (mmol)	_	_	_	_	_	0.021		
接触方法	а	а	a	а	a	a		
反応温度 (℃)	80	80	80	80	80	80		
エチレン圧(Kg/cm²G	35	35	35	35	35	35		
(注) (5)SnCl4、(6)Bu	12 SnC 12	, (7) CC	14, (8)	C12 CHCHC	12, (9)	CH ₂ Cl ₂		

(10) CBr $_4$, (11) CH $_2$ Br $_2$, (12) C $_5$ H $_1$ $_1$ Br , (13) Bu $_2$ SnBr $_2$

【0151】 * *【表6】

実施例 49 50 51 52 53 54 溶媒種類 В В В Α В В Cr (2EHA) 3 (mmol) 0.0210.0210.0210.0520.0210.021マレイミド類 (mmol) 0.0620.0620.062 $0.\,062$ 0.1560.062Eta Al (mmol) 0.3110.311 0.3110.7790.311 0.436(6) 第4成分種類 (6) (3) (14)(15)(16)0.260 第4成分 (mmol) 0.0620.0620.1680.042 0.126第4成分種類 (13)(13)(10)0.010 0.002 第4成分 (mmol) 0.042接触方法 a a a a a a 反応温度(℃) 80 80 80 80 80 80 エチレン圧(Kg/cm²G) 35 35 35 35 35 35

	実施例								
	55	56	57	58	59	60			
溶媒種類	В	В	В	A	В	В			
Cr (2EHA) 3 (mmol)	0.021	0.021	0.021	0.052	0.021	0.021			
マレイミド類(mmol)	0.062	0.062	0.062	0.156	0.062	0.062			
Et ₃ Al (mmol)	0.722	0.722	0.436	0.779	0.311	0.311			
第4成分種類	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	_			
第4成分(mmol)	0.415	1.246	0.126	0.104	0.104	_			
接触方法	a	a	a	a	а	c			
反応温度 (℃)	80	80	80	80	80	80			
エチレン圧(Kg/cm ² G)	35	35	35	35	35	35			

(注) (14) t-BuMe $_2$ SiOSO $_2$ CF $_3$ 、 (15) B(C $_6$ H $_5$) $_3$ 、 (16) CF $_3$ SO $_3$ H、 (17) C $_2$ H $_5$ OH (18) (CF $_3$) $_2$ CHOH、 (19) $_2$, $_6$ -($_1$ Bu) $_2$ C $_6$ H $_3$ OH

21

【表7】

(18) 特開平8-59732 34

	実施例						
	61	62	63	64	65	66	
溶媒種類	В	В	В	В	В	В	
Cr (2EHA) 3 (mmol)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	
マレイミド類 (mmol)	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	
Ets Al (mmol)	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	
第4成分種類	_	1	1	1	1	1	
第4成分(mmol)	_	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	
接触方法	d	e	f	g	h	i	
反応温度 (℃)	80	80	80	80	80	80	
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35	35	35	
		- 14	ا بد	1			

[0153]

33

* *【表8】

			実力	施例		
	1	2	3	4	5	6
<生成物量(g) >	7.31	3.11	18.7	25.7	4.93	9.46
<組成分布(wt%) >						
C4	11.0	14.6	6.1	0.3	41.7	29.2
C ₆ 全体	50.8	49.6	52. 4	67.7	25.7	15.1
C6 中のHX含量(wt%)	91.7	91.8	89.4	92.6	85.6	75.2
C ₈	3.6	3.4	3.8	0.4	2.6	2.5
C 1 0 - 2 0	17.7	16.6	24.8	29.6	13.6	8.9
C 2 2 - 3 0	0.8	0.6	1.3	0.6	0.6	0.0
Wax	0.0	0.0	0.3	0.1	_	_
副生PE	16.1	15.1	11.1	1.3	15.8	44.4
<触媒効率>	292	311	747	2567	197	378
<触媒活性>	5420	5770	13830	47540	3650	7010

[0154]

※ ※【表9】

	実施例						
	7	8	9	10	11	12	
<生成物量(g) >	5.08	3, 27	1, 45	3.33	4.57	8.30	
<組成分布(wt%) >							
C ₄	1.6	10.6	15.2	3.5	0.1	10.1	
C ₆ 全体	18.3	56.7	45.9	35.5	19.5	55.5	
C。中のHX含量(wt%)	90.1	92.9	90.3	79.9	89.1	85.6	
C ₈	0.8	4.4	4.2	1.0	_	4.8	
C 1 0 - 2 0	6.8	17.0	14.7	27.8	5.5	21.3	
C 2 2 - 3 0	0.3	0.9	0.4	0.4	0.0	1.0	
Wax	0.2	0.0	_	0.0	_	0.5	
副生PE	72.1	10.3	19.6	31.7	74.8	6.8	
<触媒効率>	508	131	58	333	457	664	
<触媒活性>	9410	2420	1070	6160	8470	12300	

[0155]

【表10】

		実施例									
	13	14	15	16	17	18					
<生成物量(g) >	15. 5	34.8	2.96	4.77	4.26	3.48					

(19) 特開平8-59732

<i>35</i>						<i>36</i>	
<組成分布(wt%) >							
C ₄	1.5	0.2	9.1	15.7	0.2	0.3	
C 6 全体	70.4	65.0	51.2	30.8	66. 4	6.0	
C。中のHX含量(wt%)	92.2	93. 1	91.7	94.9	96.0	67.9	
C ₈	2.0	0.3	4.3	4.8	0.5	_	
C 1 0 - 2 0	23.0	33.0	17.6	13.3	9.1	1.0	
C_{22-30}	1.2	0.2	0.9	1.6	0.2	0.0	
Wax	0.2	0.0	0.5	0.5	0.1	_	
副生PE	2.2	1.2	16.3	33. 3	23.5	92.7	
<触媒効率>	1545	3475	296	191	426	139	
<触媒活性>	28610	64360	5480	3540	7890	2580	

[0156]

* *【表11】

_	実施例							
	19	20	21	22	23	24		
<生成物量(g) >	11.9	9.64	4. 15	20.9	3.89	41.7		
<組成分布(wt%)>								
C_4	0.6	0.4	17.6	0.2	10.9	0.1		
C ₆ 全体	64.6	48.1	51.3	74.6	58.7	68.6		
C ₆ 中のHX含量(wt%)	95.8	96.9	90.8	93.8	90.7	94.1		
C ₈	0.4	0.5	2.9	0.3	4.8	0.3		
C 1 0 - 2 0	11.0	6.4	14.8	22.8	15.6	29.7		
C 2 2 - 3 0	0.3	0.2	1.0	0.2	0.6	0.2		
Wax	_	_	_	_	_	0.0		
副生PE	23. 2	44.5	12.4	1.9	9.4	1.1		
<触媒効率>	477	386	665	8375	156	4173		
<触媒活性>	8840	7140	12310	155100	1440	77280		

[0157]

※30※【表12】

_	実施例							
	25	26	27	28	29	30		
<生成物量(g) >	4.45	5. 13	15.4	26.3	1.01	6.97		
<組成分布(wt%) >								
C4	0.3	0.3	1.4	0.1	19.0	9.5		
C。全体	86.9	88.1	67.6	69.3	45.1	52.8		
C ₆ 中のHX含量(wt%)	95.1	95. 2	93.3	94.2	87.2	91.5		
C ₈	0.2	_	2.2	0.3	5.6	4.0		
C 1 0 - 2 0	9.3	8.8	24.3	28.6	15.3	19.7		
C 2 2 - 3 0	_	_	1.9	0.1	0.2	1.1		
Wax	_	_	0.6	_	_	0.1		
副生PE	3.3	2.8	2.0	1.5	14.8	12.8		
<触媒効率>	445	513	1545	2626	40	279		
<触媒活性>	8250	9510	28600	48630	750	5160		

[0158]

【表13】

		実加	 包例			
31	32	33	34	35	36	

(20) 特開平8-59732

37						38	
<生成物量(g) >	16.5	35.0	5.00	12.3	2.57	9.45	
<組成分布(wt%) >							
C ₄	7.9	7.3	0.8	13.9	9.7	11.2	
C。全体	51.4	45.3	68.5	46.0	51.1	55. 5	
C。中のHX含量(wt%)	90.7	87.1	92.2	91.0	90.5	89.4	
C ₈	4.9	4.8	0.8	3. 3	3.6	3.3	
C 1 0 - 2 0	21.6	21.3	24.3	16.7	16.1	21.6	
C 2 2 - 3 0	2.9	3.8	0.3	1.1	0.1	0.6	
Wax	1.1	1.4	_	0.2	_	_	
副生PE	10.2	16.0	6.8	18.7	18.8	7.8	
<触媒効率>	659	1398	500	491	103	378	
<触媒活性>	12210	25900	9250	9090	1900	7000	
C ₆ 全体 C ₆ 中のHX含量(wt%) C ₈ C ₁₀₋₂₀ C ₂₂₋₃₀ Wax 副生PE <触媒効率>	51. 4 90. 7 4. 9 21. 6 2. 9 1. 1 10. 2 659	45. 3 87. 1 4. 8 21. 3 3. 8 1. 4 16. 0 1398	68. 5 92. 2 0. 8 24. 3 0. 3 - 6. 8 500	46. 0 91. 0 3. 3 16. 7 1. 1 0. 2 18. 7 491	51. 1 90. 5 3. 6 16. 1 0. 1 — 18. 8 103	55. 5 89. 4 3. 3 21. 6 0. 6 - 7. 8 378	

【0159】 * *【表14】

_	実施例							
	37	38	39	40	41	42		
<生成物量(g) >	13.9	9.20	33.4	2.52	4.38	21.4		
<組成分布(wt%) >								
C ₄	8.4	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0		
C ₆ 全体	57.8	83.2	70.4	85.6	83.9	73.2		
C。中のHX含量(wt%)	89.8	95.8	94.1	95.7	95.1	94.8		
C_8	3.0	0.2	_	0.3	0.3	0.2		
C 1 0 - 2 0	22.5	13.4	28.7	11.1	12.1	19.6		
C 2 2 - 3 0	0.7	_	0.1	_	_	0.0		
Wax	0.1	_	_	_	-	0.0		
副生PE	7.6	3.1	0.8	2.8	3.4	6.8		
<触媒効率>	556	920	3337	252	438	856		
<触媒活性>	10290	17030	61800	4670	8120	15850		

43 13. 3 0. 4 74. 9	9. 64 0. 4	45 0. 86	46 3.43	47 2.98	48 3. 10
0.4			3. 43	2.98	3.10
	0.4				
	0.4				
74.0		0.0	0.2	0.5	0.3
14. 5	48.1	38.7	25.6	78.4	76.1
92.7	96.9	96.9	95.4	95.4	95. 7
0.5	0.5	_	0.2	0.2	0.2
20.4	6.4	2.8	3.4	8.9	9.4
0.3	0.2	_	0.1	_	_
0.1	_	_	_	_	_
3.4	44.5	58.0	70.4	12.0	14.0
1326	386	86	343	298	307
4560	7140	800	6350	5520	5680
_	0. 3 0. 1 3. 4 1326	0.3 0.2 0.1 - 3.4 44.5 1326 386	0.3 0.2 - 0.1 3.4 44.5 58.0 1326 386 86	0.3 0.2 - 0.1 0.1 - - - 3.4 44.5 58.0 70.4 1326 386 86 343	0.3 0.2 - 0.1 - 0.1 - - - - 3.4 44.5 58.0 70.4 12.0 1326 386 86 343 298

【0161】 【表16】

実施例

特開平8-59732

39						40	
	49	50	51	52	53	54	
<生成物量(g) >	6.07	14.9	2.56	9.75	19.6	5. 53	
<組成分布(wt%) >							
C_4	0.1	1.0	0.7	10.9	1.5	6.6	
C ₆ 全体	83.9	72.6	78.5	55.0	57.7	58.2	
C。中のHX含量(wt%)	94.5	92.8	94.7	88.7	88.5	88.5	
C_8	0.4	1.2	_	3.0	1.0	3.2	
C_{10-20}	12.2	22.5	8.1	23. 2	21.1	24.4	
C 2 2 - 3 0	_	0.6	_	0.5	1.2	0.9	
Wax	_	0.0	_	0.0	0.7	0.3	
副生PE	3.5	2.1	12,7	7.3	16.8	6.3	
<触媒効率>	607	1485	256	390	1957	553	
<触媒活性>	11240	27510	4750	7220	36240	10240	

【0162】 * * (表17]

_	実施例							
	55	56	57	58	59	60		
<生成物量(g) >	9.02	2.46	2.60	7.11	8.09	3. 21		
<組成分布(wt%) >								
C_4	5.5	0.3	17.9	9.3	6.8	5.2		
C ₆ 全体	59.1	67.1	45.7	46.8	48.4	51.9		
C ₆ 中のHX含量(wt%)	89.9	90.4	89.6	90.6	88.6	90.7		
C ₈	3.3	0.6	4.9	3. 5	3.7	2.7		
C ₁₀₋₂₀	23.1	13.3	20.6	20.1	23.8	15.3		
C 2 2 - 3 0	1.1	_	0.9	1.1	1.3	0.9		
Wax	0.1	_	0.4	0.1	0.3	0.2		
副生PE	7.8	18.7	9.6	19. 1	15.7	23.8		
<触媒効率>	902	246	260	284	648	321		
<触媒活性>	16710	4560	4820	5260	11990	5950		

_	実施例						
	61	62	63	64	65	66	
<生成物量(g) >	3.86	24.6	12.6	10.2	3.59	3.94	
<組成分布(wt%) >							
C_4	11.1	0.5	0.4	0.1	0.0	0.3	
C ₆ 全体	50.9	63.3	70.2	68.6	82.8	87.9	
C。中のHX含量(wt%)	91.5	91.9	91.9	92.6	94.8	95. 3	
C ₈	3.3	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	
C 1 0 - 2 0	19.0	29.6	21.7	23.0	6.7	8.6	
C 2 2 - 3 0	0.7	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	
Wax	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	
副生PE	1.48	5.7	6.3	6.0	10.3	3.2	
<触媒効率>	386	2458	1265	1023	359	394	
<触媒活性>	7140	45510	23420	18940	6650	7300	

【0164】 工業的有利に1-ヘキセン等の α -オレフインの低重合【発明の効果】本発明方法によれば、煩雑な操作なしで 50 物を高収率かつ高選択率で製造することが出来る。ま

た、全体の製造プロセスに要する建設費が安いという利点を有するため、本発明の工業的価値は顕著である。

フロントページの続き

(72)発明者 高原 潤

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 岩出 慎二

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内

(72)発明者 難波 美明

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学

株式会社水島開発研究所内